附件1

中关村科学城集成电路流片补贴申报指南

（征求意见稿）

依据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《北京市高精尖产业发展资金管理办法》等文件，为落实《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》，充分发挥海淀区财政资金的引导作用，特制定《中关村科学城集成电路流片补贴申报指南》（以下简称《申报指南》）。

1. 支持依据

**第一条** 根据《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》，支持集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），推动集成电路设计企业加大研发投入，降低设计企业流片成本，加快推进集成电路产业高质量发展。

二、支持对象及申报条件

**第二条** 申报单位为在海淀区登记注册、具有独立法人资格、从事集成电路设计业务的企业。

**第三条** 申报单位需在相关期限内开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），且产品流片合同已执行完毕，并在海淀区开展该产品产业化工作。

**第四条** 申报单位需拥有产品的自主知识产权。

三、支持内容和标准

**第五条** 支持集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）首轮流片，对符合条件的企业按照流片费用一定比例予以奖励。

1.对在境内开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的50%予以奖励，单个企业上限300万元。

2.对在境外开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限200万元。

**第六条** 支持集成电路设计企业开展工程产品首轮流片（全掩膜），对符合条件的企业按照流片费用一定比例予以奖励。

1.对在境内开展先进制程（14nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限800万元；对在境内开展成熟制程（14nm以上）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的20%予以奖励，单个企业上限500万元。

2.对在境外开展先进制程（14nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的15%予以奖励，单个企业上限500万元。

**第七条** 若有多个产品符合多项申报条件可同时申报，单个企业本年度奖励金额最高不超过1500万元。

四、实施方式

**第八条** 申报审核方式。政策申报审核采取线上申报，并将纸质版申报材料提交至中关村科学城管委会，中关村科学城管委会根据企业申报材料组织第三方进行审核。

**第九条** 资金计划。中关村科学城管委会根据当年海淀区流片补贴专项资金预算额度，拟定资金拨付计划建议。

**第十条** 资金拨付。按照区财政专项资金管理的相关要求,中关村科学城管委会根据最终资金拨付计划，将资金拨付至企业指定账户。

第五章 附 则

**第十一条** 本细则由中关村科学城管委会负责解释。

**第十二条** 本细则自印发之日起实施，有效期至2027年12月31日。